

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成 17 年 9 月 22 日 (2005.9.22)

【公開番号】特開 2003-75596 (P2003-75596A)

【公開日】平成 15 年 3 月 12 日 (2003.3.12)

【出願番号】特願 2002-168255 (P2002-168255)

【国際特許分類第 7 版】

G 2 1 K 4/00

G 0 1 T 1/00

【F I】

G 2 1 K 4/00 M

G 2 1 K 4/00 A

G 0 1 T 1/00 B

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 4 月 19 日 (2005.4.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

燐光体層及び保護層を含む燐光体パネルであって、燐光体層が主表面と縁を有するものにおいて、前記保護層が少なくとも二つの層、即ち前記燐光体層に最も近い層 A と前記燐光体層から遠い層 B に分割されていること、及び前記層 A がパリレンの層であり、前記パリレンがパリレン C、パリレン D 及びパリレン H T からなる群から選択されることを特徴とする燐光体パネル。

【請求項 2】

前記層 B が最外層であり、厚さ t を有し、テーバー摩耗試験（サンドペーパー P 2 2 0、荷重 2 5 0 g、5 0 0 回）において前記厚さ t の最大 2 0 % を失う請求項 1 に記載の燐光体パネル。

【請求項 3】

前記層 B が放射線硬化されたポリマー層である請求項 1 又 2 に記載の燐光体パネル。

【請求項 4】

前記パネルが結合剤のない光刺激性燐光体層を含み、前記結合剤のない光刺激性燐光体層が C s X : E u 刺激性燐光体（式中、X が B r 及び C l からなる群から選択されたハロゲン化物を表す）を含有する請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の燐光体パネル。

【請求項 5】

パネルが前記燐光体層の前記主表面より大きい表面を有する支持体を含み、かくして前記燐光体層が前記支持体の部分を開放し、前記層 A が前記燐光体層によって開放された前記支持体の前記部分の少なくとも一部をカバーする請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の燐光体パネル。

【請求項 6】

下記工程を含む結合剤のない燐光体パネルの製造方法：

- 支持体を準備する；
- C s X : E u 燐光体（式中、X は B r 及び C l からなる群から選択されたハロゲン化物を表す）を蒸着して前記支持体上に結合剤のない燐光体層を形成する；
- 化学蒸着によってパリレンの層を前記結合剤のない燐光体層上に適用して層 A を形

成する；

- 前記層 A の上部に放射線硬化性溶液を適用する；
- UV 及び / 又は電子線露光によって前記パネルを硬化して層 B を形成する。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0020】

好適なダイマー - 例えば P A R Y L E N E N の蒸着のためのシクロ - ジ ( p - キシレン )、P A R Y L E N E C の蒸着のためのシクロ - ジ ( p - 2 - クロロキシレン ) 又は P A R Y L E N E D の蒸着のためのシクロ - ジ ( p - 2 , 6 - ジクロロキシレン ) - は加熱され、二つのラジカルに分解する。これらのラジカルは燐光体層上に蒸着され、そこでそれらは重合してポリマー層を形成する。パリレン層 ( P A R Y L E N E N , C 又は D のいずれか ) の化学蒸着は幾つかの利点を有する： - 層はピンホールなしで蒸着される  
- バリヤー層は燐光体層の主表面上に蒸着されるだけでなく、縁上にも蒸着され、かくして燐光体層の封止が完了する。